

ALIGNÉUSE

FABRICANT : EV Group

MODÈLE : EVG 620

Échantillons

- Taille de photomasques : 178 mm (7 po) maximum
- Taille d'échantillons : 150 mm maximum

Caractéristiques

- Source : lampe au mercure 1 000 W
- Sélection spectrale : I-line
- Optique : miroir diélectrique UV moyen (350 nm – 450 nm)
- Sélection de longueur d'onde possible par filtre passe-bande
- Mode d'exposition: proximité, contact ou sous vide, UV-Nanoimprint
- Alignement: par caméra CCD programmable par face avant ou arrière
- Précision d'alignement: 0.5 μm avec lentille 20 X

PROCÉDÉS DE ROUTINE

Photolithographie mode contacte

Sur : résines positives

- Taille de motif minimal atteinte : 0.6 μm
- Épaisseur atteinte : 0.5 μm à 10 μm

Sur: SU8

- Taille de motif minimal atteinte : -
- Épaisseur atteinte : 1 μm à 200 μm

PROCÉDÉS DE ROUTINE

Photolithographie mode contacte

Sur : résines négatives

- Taille de motif minimal atteinte : 0.7 μm
- Épaisseur atteinte : 0.7 μm à 10 μm